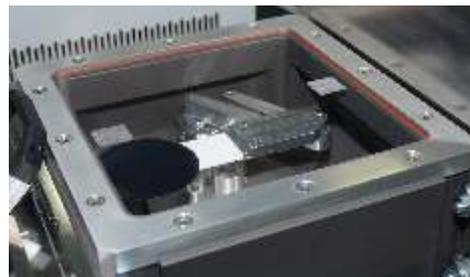




ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ СЛОЕВ ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ С ИСР ИСТОЧНИКОМ И ШЛЮЗОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ

ИЗОФАЗ ТМ 200-01

Назначение: Атомно-слоевое осаждение сверхтонких пленок.



Особенности:

- Групповая и индивидуальная обработка подложек на подложкодержателе в одном технологическом цикле: 60x48 мм – 7 шт.; Ø 76мм – 4 шт.; Ø 100, 150, 200мм – 1 шт.;
- Шлюзовая камера для загрузки – выгрузки подложек;
- Транспортная система переноса подложек из шлюзовой камеры в рабочую камеру на основе робота-манипулятора;
- Осаждение в термическом режиме и в режиме с удаленным источником ИСР плазмы;
- Порты для подключения ампул с прекурсором: с высоким давлением насыщенных паров – 2 шт.; с низким давлением насыщенных паров – 2 шт. (опционально до 4 шт.);
- Мощность потребления не более 14 кВт;
- Безмасляная система откачки;
- Возможность встраивания в чистую комнату.

